

06.2;06.3;07

©1994

# СВЕТОДИОДЫ НА ОСНОВЕ InAsSbP ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА 2.6–3.0 мкм( $T = 300$ К)

*Т.Н.Данилова, А.Н.Именков,  
К.Д.Моисеев, И.Н.Тимченко, Ю.П.Яковлев*

1. Спектральный диапазон 2.6–3.0 мкм перспективен для целей влагометрии и газового анализа, поскольку в нем находятся линии поглощения  $H_2O$  в области 2.75–2.85 и линии поглощения некоторых газов, например  $CO_2$ , в области 2.64–2.87 и  $H_2S$ –2.63 мкм. Об источниках излучения, работающих при комнатной температуре в этом спектральном диапазоне, не сообщалось. Светодиоды, созданные на основе  $GaInAsSb/GaSb$ , излучают при комнатной температуре от 1.7 до 2.5–2.6 мкм [1,2]. На основе многокомпонентных твердых растворов InAs, а именно InAsSbP и InAsSb, разработаны светодиоды, излучающие при комнатной температуре в более длинноволновом спектральном диапазоне от 3.0 до 4.8 мкм [3]. Недавно нами разработаны и изготовлены для спектральной области 2.6–3.0 мкм на основе InAsSbP лазеры, работающие при азотной температуре [4]. Однако для практического использования удобны источники, излучающие при комнатной температуре.

Целью настоящей работы явилось создание светодиодов на основе InAsSbP, излучающих в области 2.6–3.0 мкм при комнатной температуре.

2. Изготовленные и исследованные в работе светодиоды представляют собой двойную гетероструктуру (ДГС) (рис. 1) с активной областью и широкозонными областями из изопериодных к InAs твердых растворов  $InAs_{1-x-y}Sb_yP_x$ , но с разным содержанием фосфора  $x$ . Светодиодные гетероструктуры выращивались методом жидкофазной эпитаксии (ЖФЭ) на подложке InAs [100] с рассогласованием параметров решеток не более  $1.2 \cdot 10^{-3}$ . Активная область структуры толщиной 4 мкм была  $p$ -типа и легирована Zn до концентрации дырок  $8 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$ . Содержание фосфора  $x$  в активной области варьировалось от 0.12 до 0.27. Широкозонный слой  $p$ -типа толщиной  $\sim 2.5$  мкм легирован Zn до концентрации дырок  $2 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ . Широкозонный слой  $n$ -типа толщиной  $\sim 2$  мкм легирован Sn до концентрации электронов  $5 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ . Содержание фосфора в широкозонных облас-

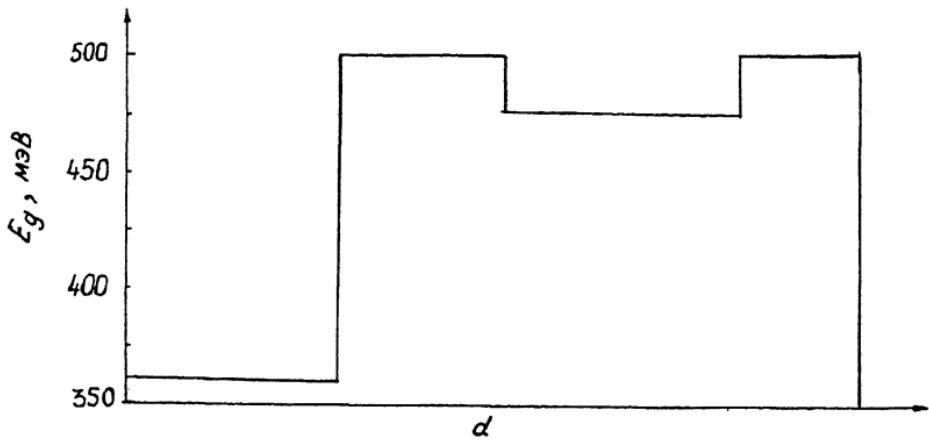
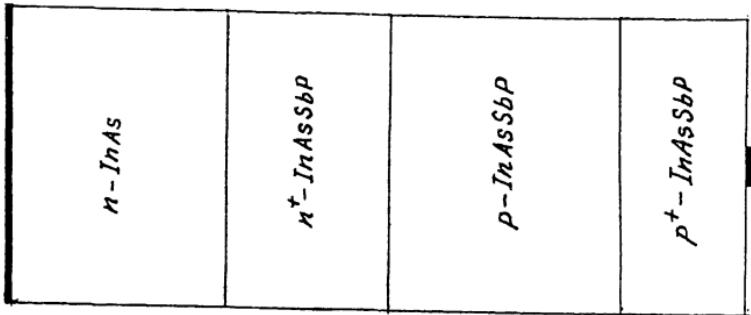


Рис. 1. а — схема расположения слоев в структуре светодиода, б — послойный профиль ширины запрещенной зоны  $E_g$ .

тях соответствовало  $x = 0.30$ . Состав четвертого раствора слоев определялся с помощью рентгеновского микроанализатора (САМЕВАХ). Рассчитанный послойный профиль ширины запрещенной зоны ( $E_g$ ) приведен на рис. 1 для самой широкозонной активной области с  $E_g = 0.475$  эВ. В ограничивающих слоях ширина запрещенной зоны  $E_g = 0.500$  эВ. Из эпитаксиальных структур изготавливались мезасветодиоды с диаметром мезы 300 мкм.

Исследовались спектры излучения в зависимости от тока ( $I$ ), характеристики ток–напряжение ( $I$ – $V$ ), определялся внешний квантовый выход излучения ( $\eta$ ) и мощность излучения ( $P$ ) в зависимости от тока. При токах 100 мА светодиоды питались меандром с частотой 40 Гц, а при больших токах — пакетами импульсов с длительностью 300–1000 нс и частотой следования  $10^5$  Гц.

3. Спектры излучения при комнатной температуре имеют основную и дополнительную полосы (рис. 2). Энергия максимума основной полосы  $m_{\max}$  на 20 мэВ меньше  $E_g$ ,

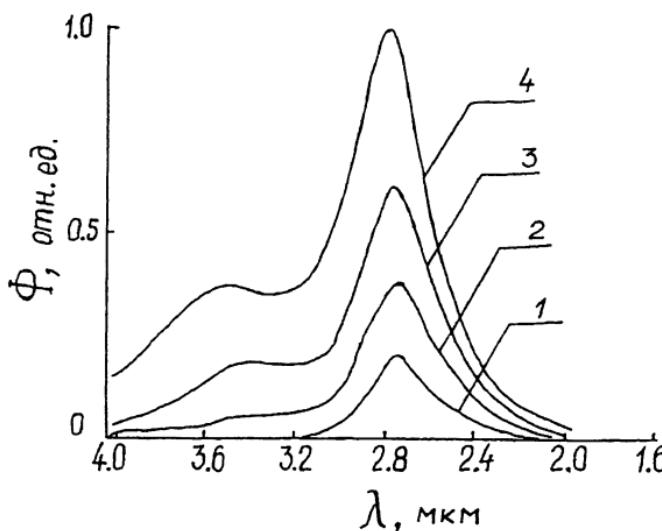


Рис. 2. Спектры излучения светодиода МК-396 № 2 при токах, А: 1 — 0.1, 2 — 0.2, 3 — 0.4; 4 — 1.

узкозонного слоя. Дополнительная полоса имеет энергию максимума 0.365 эВ и проявляется при токах  $> 0.2$  А. Интенсивность ее растет с током быстрее, чем основной полосы, и при токе 1 А составляет 38 % от интенсивности основной полосы. При больших токах, когда эффективное значение тока превышает  $\sim 20$  мА, наблюдается небольшой длинноволновый сдвиг, вызванный нагревом светодиода.

Вольт-амперная характеристика светодиодов при комнатной температуре (рис. 3) имеет прямолинейный участок, дающий отсечку 0.5 В и наклон, соответствующий остаточному сопротивлению  $R_s = 5$  Ом. Квантовый выход излучения светодиодов составлял величины 0.02–0.03 % при комнатной температуре и токе 50 мА.

Мощность излучения светодиодов в зависимости от тока при комнатной температуре (рис. 4) возрастает сверхлинейно при  $I < 50$  мА, линейно в интервале токов 50–200 мА и сублинейно при более высоких токах. Мощность излучения при постоянном токе 50 мА составляет 6–10 мкВт, а при токе 1 А импульсная мощность имеет величину 100–150 мкВт.

#### 4. Проанализируем полученные результаты.

Поскольку максимум основной полосы на  $\sim 20$  мэВ меньше  $E_g$  и не сдвигается с током, а активная область светодиодов *p*-типа, то, вероятно, излучение обусловлено рекомбинацией зона проводимости–акцептор. Интерфейсной полосы в излучении не наблюдается, что вполне вероятно из-за отсутствия на границе активной области *n–n* перехода. Наблюдаемая дополнительная полоса по энергии максимума соответствует квазимежзонной рекомбинации в InAs. Интенсивность этой полосы возрастает с увеличением тока,

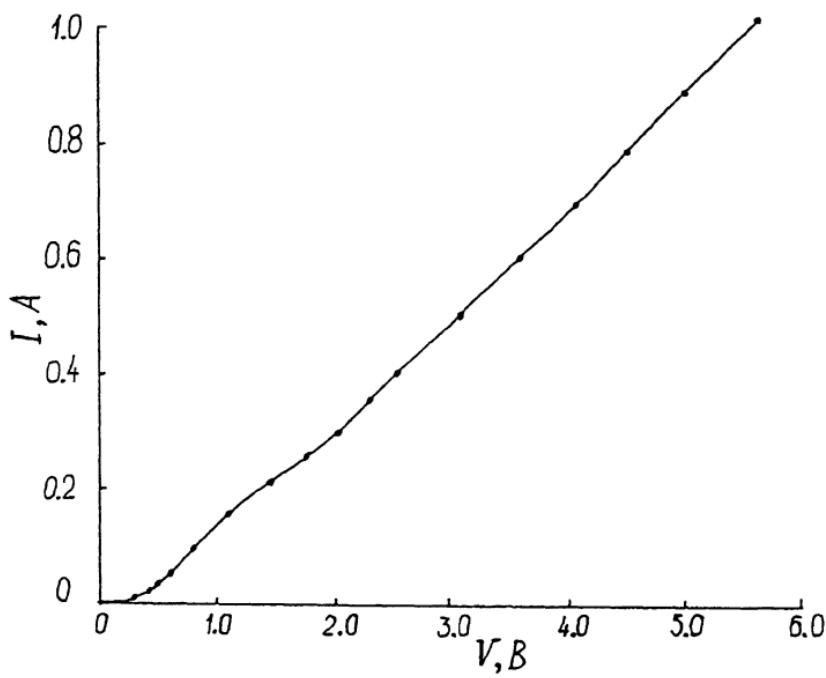


Рис. 3. Вольт-амперная характеристика светодиода МК-396 № 2.

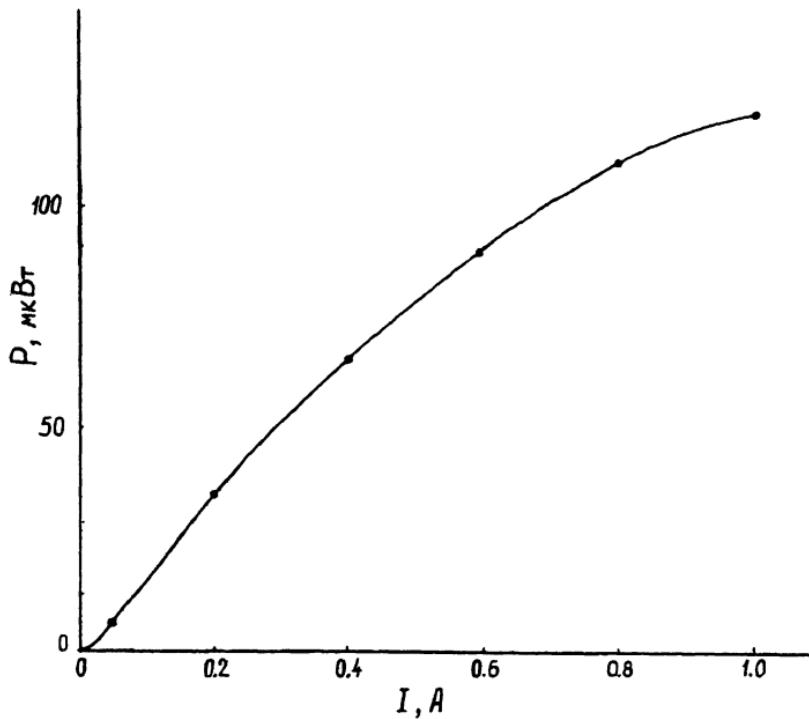


Рис. 4. Зависимость мощности излучения  $P$  светодиода МК-396 № 2 от тока  $I$ .

поскольку с увеличением тока возрастает утечка неосновных носителей из активной области в подложку InAs.

Таким образом, методом ЖФЭ на основе твердого InAsSbP созданы светодиоды, работающие в спектральной области 2.6–3.0 мкм при комнатной температуре.

Авторы выражают благодарность А.А.Рогачеву за помощь и поддержку работы.

### Список литературы

- [1] Андаспаева А.А., Баранов А.Н., Гребенщикова Е.А., Гусейнов А.А., Именков А.Н., Рогачев А.А., Филаретова Г.М., Яковлев Ю.П. // ФТП. 1989. Т. 23. В. 8. С. 1373–1377.
- [2] Именков А.Н., Капранчик О.П., Литвак А.М., Попов А.А., Чариков Н.А., Яковлев Ю.П. // Письма в ЖТФ. 1990. Т. 16. В. 24. С. 19–24.
- [3] Баранов А.Н., Именков А.Н., Капранчик О.П., Негрескул Валер.В., Черняевский А.Г., Шерстнёв В.В., Яковлев Ю.П. // Письма в ЖТФ. 1990. Т. 16. В. 24. С. 42–47.
- [4] Данилова Т.Н., Еришов О.Г., Именков А.Н., Тимченко И.Н., Шерстнёв В.В., Яковлев Ю.П. // Письма в ЖТФ. 1994. Т. 20. В печати.

Физико-технический  
институт им. А.Ф.Иоффе  
Санкт-Петербург

Поступило в Редакцию  
14 марта 1994 г.